

전기주석도금강판의 Reflow 시 용융 거동에 미치는 도금액 온도의 영향

Effect of electrolyte temperature on the flow melting behaviors during reflow treatment of electrolytic tinplate

김태업*, 조준형, 이재룡, 배대철 (POSCO 기술연구소), 흥기정 (포항산업과학연구원)

1. 서 론

전기주석도금강판은 전기 도금층을 reflow 공정에서 저항가열에 의해 용융시켰다가 quenching 시킴으로써 광택성을 갖는 도금층을 형성시킨 것이다. 전기주석도금은 도금 액 조건뿐만 아니라 도금 부착량에 따라서도 적정 도금범위가 달라지며, 특히 후도금 재에서는 도금액 온도에 따라 전기 도금층의 형상이 크게 변하게 된다. 본 연구는 전기 도금층의 형상 및 우선배향에 따른 reflow 과정에서의 용융 거동과 reflow 후의 표면 특성에 대해 조사한 것이다.

2. 실험 방법

Circulation cell에서 도금액 온도를 변화시키면서 전기주석도금을 11.2 g/m^2 실시하고, drag-out 용액으로 fluxing 처리후 저항가열방식으로 reflow를 실시하였다. Reflow 과정에서 전압을 조절하여 국부적인 부위에서만 melting이 일어나도록 하면 시편 표면에서의 온도분포에 의해 matte 상태와 reflow 상태의 경계면이 형성되고, 그 경계면을 분석하면 reflow 시 도금층이 용융되는 과정을 관찰할 수 있게 된다.

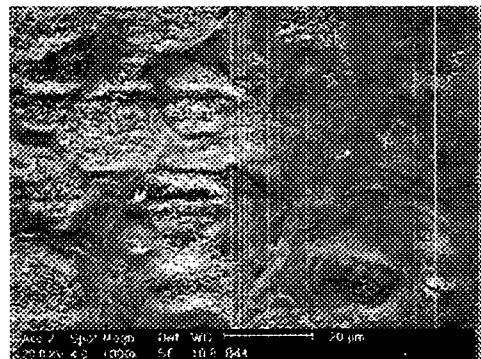


Fig.1 Morphological change observed at the interface between matte and reflowed area

3. 결과 요약

전기 주석도금층은 Sn(002)면으로부터 $<100>$ 방향으로 성장하는데, 도금액 온도가 낮을 때는 핵생성이 충분치 않은 상태에서 (002)면이 표면에 평행한 방향으로 형성되어 이웃하는 결정핵들과 서로 간섭하지 않고 수직방향으로만 성장하기 때문에 porous 한 도금층이 형성된다. 도금액 온도가 높아지면 핵생성이 활발해지면서 (002)면이 시편 표면에서 약간 기울어진 방향으로 형성되므로 성장하는 결정핵들이 서로 간섭하여 동일 방향으로의 성장을 방해하므로 random 하면서 compact 한 결정을 형성하게 된다.

Reflow 시 전기도금층은 matte 상태에서 contraction, island formation, wetting의 천이과정을 거쳐 reflow 상태로 변하게 되는데¹⁾, 낮은 온도에서 형성된 도금층은 천이 과정이 일어나는 영역이 넓은데 비해, 높은 온도에서 형성된 도금층은 reflow 시 결정핵들 간의 열전달이 원활하여 천이 영역의 폭이 매우 좁게 된다.

1) H.Bunk et al, Proc. 4th. Continuous Strip Plating Symp., AESF (1984)